

СОДЕРЖАНИЕ

Том 52, номер 5, 2023

ДИАГНОСТИКА

Электрофизические параметры и эмиссионные спектры тлеющего разряда дифтордихлорметана

Д. Б. Мурин, И. А. Чесноков, И. А. Гоголев, А. Э. Гришков

347

ЛИТОГРАФИЯ

Защитные свободновисящие пленки для установок проекционной литографии экстремального ультрафиолетового диапазона

*С. Ю. Зуев, А. Я. Лопатин, В. И. Лучин, Н. Н. Салащенко,
Н. Н. Цыбин, Н. И. Чхало*

354

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Моделирование влияния решеточных дефектов на работу разделения соединенных материалов

Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев

367

Компьютерное исследование влияния неоднородностей высокоомного слоя на резистивные переключения в структуре на основе микрокристалла селенида висмута

В. В. Сироткин

374

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О влиянии малых добавок F_2 , H_2 и NF на концентрации активных частиц в плазме тетрафторметана

А. М. Ефремов, С. А. Смирнов, В. Б. Бетелин

383

ПАМЯТЬ

Закономерности формирования подвижных локализованных магнитных конфигураций и технология изготовления структур для реализации элементов магнитной памяти

А. В. Проказников, В. А. Папоров, В. А. Чириков, Н. А. Евсеева

390

ПРИБОРЫ

Нейроморфные системы: приборы, архитектура и алгоритмы

К. А. Фетисенкова, А. Е. Рогожин

404

Влияние деградации горячих носителей на характеристики высоковольтного КНИ транзистора с большой областью дрейфа

А. С. Новоселов, Н. В. Масальский

423

ТЕХНОЛОГИИ

Влияние материала электродов на электроформовку и свойства мемристоров на основе открытых “сэндвич”-структур металл– SiO_2 –металл

В. М. Мордвинцев, С. Е. Кудрявцев, В. В. Наумов, Е. С. Горлачев

431